

EV GROUP Leads Advanced Optical Lithography with Next-Generation EVG150 Resist Processing Platform – November 7, 2022

EV GROUP、次世代の EVG150 レジスト処理プラットフォームで先端光リソグラフィをけん引



2022年11月08日(火)12:44

AsiaNet 98670

EV GROUP、次世代の EVG150 レジスト処理プラットフォームで先端光リソグラフィをけん引

業界をリードする前世代の性能を維持しつつ、200mm基板向けプラットフォームを再設計

モジュール容量の増加によるスループットの向上、装置フットプリントの縮小を実現

オーストリア ザンクト・フローリアン, 2022年11月8日 /PRNewswire/ -- MEMS、ナノテクノロジーデバイス、半導体製造向けウェーハ接合およびリソグラフィ装置のリーディングサプライヤーであるEV Group（以下、EVG）は本日、200 mm 基板対応の次世代EVG（R）150全自動レジストプロセス装置を発表し、光リソグラフィソリューションのポートフォリオを強化したことを発表しました。新しいプラットフォームとして設計されたEVG150は、前世代と比べて、スループットを高める（最大 80%）だけでなく汎用性をさらに向上させ、装置フットプリントも約50%に縮小させるなど、先端機能の追加と更なる機能の拡張を実現しています。最先端パッケージング、MEMS、高周波（RF）、3Dセンシング、パワーエレクトロニクス、フォトニクスなど、さまざまなデバイスやアプリケーションをサポートするユニバーサルプラットフォームであるEVG150は、高い信頼性で高品質の塗布/現像プロセスを提供します。高いスループット、柔軟性、再現性で大量生産と産業向け開発用途の両方における最も厳しいニーズに応えます。

https://www.excite.co.jp/news/article/Kyodo_prw_202211089411/